## 4D12

## Si、Ge(111)-2×1 表面のステップ構造および バイアス依存型 STM 像の電子状態計算

(鳥取大院・エ<sup>1</sup>, JST-CREST<sup>2</sup>) 〇谷川 雅一<sup>1</sup>, 小田 泰丈<sup>1</sup>, 星 健夫<sup>1,2</sup>, 石井 晃<sup>1</sup>

【序】

近年開発された超大規模電子構造計算[1] (タイトバインディング型ハミルト ニアンを用いたオーダーN計算法)により、Si(111)単結晶のへき開で形成され るステップ構造が予言された[1](図[1])。一方、へき開によって現れるSi(111)・2 ×1平坦表面がバイアスに依存したSTM像をもつことは古くから知られており、 それは実験からも確認されている[2]。Si(111)・2×1表面のステップ構造はSTM 実験では得られている(論文[1]の文献を参照)ものの、原子構造の特定には至 っていない。そこで、本研究では、ステップエッジ近傍付近に相当する系に対 し、第一原理計算(密度汎関数理論・平面波基底)をもちいて、ステップエッ ジ部分の原子構造決定およびバイアス依存型STM像を示した。また、Ge(111)・2 ×1表面のステップ構造についても同様の結果が得られた。

【計算】

計算はSi(111)-2×1表面のステップ 構造について密度汎関数理論、平面波 基底を用いた第一原理分子動力学 (プ ログラムパッケージ 「VASP」) によっ て計算した。2つの(準)安定構造を 見つけた上で、それぞれにたいして、 局所状態密度(LDOS)、バイアス依 存を示す STM 像を計算した。 Ge(111)-2×1 表面のステップ構造に ついても同様に計算した。k点は1×6 ×1 でサンプリングし、カットオフエ ネルギーは 400eV、奥行き方向にのみ 周期性を与え、Si原子 96 原子、H原 子は21原子でステップ構造を構成し ている(図[2]の構造は第一原理分子動 力学計算で得られた安定構造)。



図[1]:大規模電子構造計算による、 Si(111)単結晶のへき開プロセス[1]。





図[2]:平面波基底第一原理分子動力学 計算による Si(111)-2×1 表面のステ ップ構造。(a)はステップエッジ周辺の top view、(b)は side view。

【結果と考察】

図[2]に、安定構造を示した。7員環 と5員環が、2×1構造の基本単位と なる。ステップエッジ(原子A,Bを含 む部分)には、6員環が現れる。なお 計算では、ステップエッジ部分(原子 A、B)が逆にチルトした、準安定構 造も得られており、エネルギーは安定 構造より $\Delta$ E=0.19eV(単位構造あた り)だけ高い。以下では安定構造(図 [2])についてのみ述べる。

表面原子 A~D について、それぞれ の局所状態密度計算を行った結果を 図[3]に示す。ステップエッジの原子 A、 原子 B に注目するとフェルミエネル ギー ( $E_F$ =0.0eV)の挟んで正負のエ ネルギー領域で異なる原子の状態の ピークが確認できる。

波動関数の広がりから、実験で得ら れるべき STM 像を図[4]に示す。この 図[4]は正負のバイアスを設定してお り、バイアスの違いによって STM 像 で光る原子が異なっていることがわ かる。

同様の結果が、Ge(111)-2×1 表面に ついても得られた。

本研究は理論からの予言として、 STM 像解析に重要な知見を与えてお り、超大規模電子構造計算と平面基底 第一原理計算を組み合わせた階層的 理論アプローチの一般的有用性を示 している。



図[3]:ステップエッジの原子の局所状 態密度。表面原子 A~D は図[2]で示し た原子に対応しており、フェルミエネ ルギー $E_F$  は  $E_F$ =0.0eV に設定してい る。



図[4]:バイアス依存型 STM 像。バイ アス電圧は(a)が V=0.5eV、(b)が V=-0.5eV で(a)では原子 B が、(b)では 原子 A が光っている。

References

[1] T. Hoshi, Y. Iguchi, and T.

Fujiwara, Phys. Rev. B72, 075323 (2005);星健夫・藤原毅夫, 日本物理 学会誌, 2006 年4 月号, pp.256-259; http://www.elses.jp

[2] J. A. Stroscio, R. M. Feenstra, and A. P. Fein, PRL 57, 2579 (1986)